

CTP-A

THERMAL CTP ANODIZED PLATE



LP
LITHOPLATE
PLATES AND PRODUCTS FOR OFFSET

Plancha CTP Térmica Anodizada

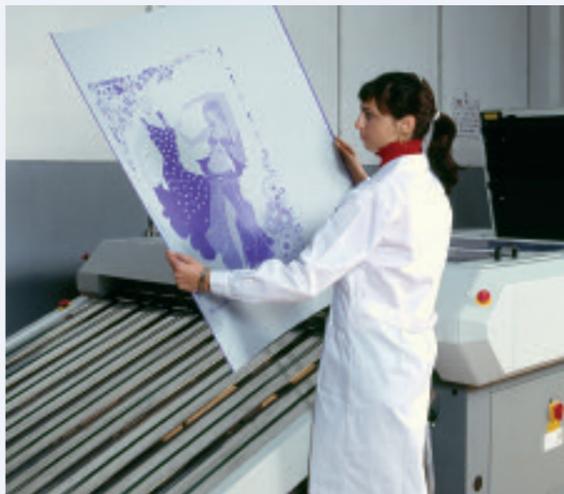
Plancha CTP térmica de alto rendimiento, provista de grano electro-químico, anodizada e hidrofiliada y capa termo-sensible perfeccionada para 830 nm.

Características Técnicas

Plancha térmica positiva para grabar en equipos CTP con diodos láser infrarrojos (IR) entre 800-850 nm. No precisa pre-horneado. Superficie no impresora anodizada.

VENTAJAS

- De fácil exposición y revelado
- Compatible con la mayoría de los reveladores del mercado
- Máxima resolución para la reproducción de tramas estocásticas
- Rápido equilibrio agua-tinta
- Alto contraste y estabilidad
- Tirajes de más de 100.000 impresiones sin horneado
- Supera las expectativas de los usuarios, optimizando el rendimiento en la impresión



Exposición / Emulsión

Color de la emulsión: azul intenso
Contraste post-revelado: muy alto
Sensibilidad a la luz ambiente: una exposición de hasta 2 horas no le afecta
Sensibilidad espectral: 800-850 nm. Máxima sensibilidad a 830 nm.
Utilizable con la mayoría de los equipos de grabación térmicos: Creo, Heidelberg, Screen, Lüscher, etc...
Energía requerida: 120-130 mj/cm²
Reproducción punto: entre 1-99% a 250 l.p.i. y tramas FM

Revelado

Utilizar revelador Revelith-CTP a 23°C ± 1°C
Compatible con la mayoría de los reveladores de planchas térmicas del mercado
Tiempo de revelado: 30 segundos ± 5 segundos
Regeneración: con el mismo revelador a razón de 120-140 ml/m²

Engomado

Utilizar Gomalux-LP
Para proceso de termo endurecido en horno utilizar Quemagum-LP

Corrección

Utilizar lápices correctores Dualpoint-LP

Horneado

El endurecimiento de la emulsión con el horneado permite tirajes muy elevados, superiores a 500.000 impresiones.